



戦略分野国内生産促成税制の見直し（1/2）

一言解説

投資や賃上げに消極的な大企業の行動変容を促すため、特定税額控除規定の不適用措置の他、戦略分野国内生産促進税制に係る税額控除規定の適用要件についても見直しが行われます。

1. 概要

- (1) 現行制度では、半導体又は特定産業競争力基盤強化商品生産設備を取得した場合の法人税額の特別控除（戦略分野国内生産促進税制）は、生産段階でのコストが高く、民間として事業採算性に乗りにくいものの、国として特段に戦略的な長期投資が不可欠となる分野の投資を促進するための税額控除制度となります。青色申告書を提出する法人で令和6年9月2日から令和9年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る認定事業適応事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品のうち、半導体又は特定産業競争力基盤強化商品の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、半導体生産用資産又は特定商品生産用資産の取得等をして、これを国内にある事業の用に供したときは、その事業の用に供した日からその認定の日以後10年を経過するまでの期間内の日を含む各事業年度において税額控除ができるとともに、繰越税額控除限度超過額を3年間（一定の場合には4年間）繰越できる制度になります。
- (2) 上記(1)の税額控除制度については、投資や賃上げに消極的な大企業の行動変容を促すため、適用要件等の見直しが行われます。

2. 改正の内容

- (1) 特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けた特定機械装置等の取得価額は、半導体税額控除限度額の計算の基礎となる半導体生産用資産及びこれとともに半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に投資した金額に含めないこととします。
- (2) 特定生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けた特定機械装置等の取得価額は、特定商品税額控除限度額の計算の基礎となる特定商品生産用資産及びこれとともに特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に投資した金額に含めないこととします。

適用時期

戦略分野国内生産促進税制の適用時期は、令和6年9月2日から令和9年3月31日までの間となります。



戦略分野国内生産促成税制の見直し（2/2）

（3）適用要件の見直し

以下の①の要件に加え、②又は③の**いずれかの要件に該当しない場合**（現行ではいずれにも該当しない場合）には、上記税額控除の規定が不適用となります。

① 所得金額要件（その事業年度が設立事業年度及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合にのみ判定します。）

現行	改正案
その事業年度の所得金額 ≤ 前事業年度の所得金額	同左

② 継続雇用者給与等支給額に係る要件

現行	改正案
継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合（対前年度増加率）：1 %以上	継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合（対前年度増加率）： 2 % 以上

③ 国内設備投資額に係る要件

現行	改正案
国内設備投資金額 > 当期減価償却費総額 × 40%	同左